



OMNIS MISP Unit

2.1056.1110

OMNIS MISP Unit は、様々な Metrohm インラインサンプル前処理技術 (Metrohm Inline Sample Preparation 「MISP」)、ならびにリキッドハンドリングプロセス用の付属品のホルダーおよびトレイとして機能します。トレイが付いた新しい設計により、付属部品を簡単に装着もしくは交換することができます。この機能により、スペースを節約し、整理整頓して収納でき、フローパスに統合することができます。

OMNIS MISP Unit を使えば、対応する付属品を用いて以下の Metrohm インラインサンプル前処理技術を実行できます:

- Metrohm インライン限外ろ過 (UF)
- Metrohm インライン希釈 (MIDT)
- Metrohm インライン希釈と Metrohm インライン限外ろ過の組み合わせ (MIDT-UF)
- Metrohm インライン透析
- Metrohm インテリジェント可変注入テクニック (MiPT)
- Metrohm インライン限外ろ過と Metrohm インテリジェント可変注入テクニックの組み合わせ (UF-MiPT)
- Metrohm インテリジェント濃縮技術 (MiPCT)
- Metrohm インテリジェント濃縮技術とマトリックス除去 (MiPCT-ME)
- Metrohm インテリジェントピックアップ注入テクニック (MiPut)

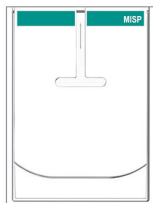
- Metrohm インライン中和と Metrohm インライン陽イオン除去
- Metrohm インテリジェント濃縮技術とインライン中和 (MiPCT-NE)

OMNIS MISP Unit では、限外ろ過セル、透析セル、移送チューブまたは移送キャピラリーを使用できます。オプションの MISP ホルダーを用いて、Metrohm で入手できるすべてのトラップカラムを取り付けることができます。オプションの MISP ベースプレートには、様々なコネクタを固定し、フローパスに統合させることができます。

納品範囲 2.1056.1110

Order Number	説明	数量
--------------	----	----

1.1056.1110

**OMNIS MISP Unit**

1 PCS

OMNIS MISP Unit は、様々な Metrohm インラインサンプル前処理技術 (Metrohm Inline Sample Preparation "MISP")、ならびにリキッドハンドリングプロセス用の付属品のホルダーおよびトレイとして機能します。トレイが付いた新しい設計により、付属部品を簡単に装着もしくは交換することができます。この機能により、スペースを節約し、整理整頓して収納でき、フローパスに統合することができます。

OMNIS MISP Unit を使えば、対応する付属品を用いて以下の Metrohm インラインサンプル前処理技術を実行できます：

- Metrohm インライン限外ろ過 (UF)
- Metrohm インライン希釈 (MIDT)
- Metrohm インライン希釈と Metrohm インライン限外ろ過の組み合わせ (MIDT-UF)
- Metrohm インライン透析
- Metrohm インテリジェント可変注入テクニック (MiPT)
- Metrohm インライン限外ろ過と Metrohm インテリジェント可変注入テクニックの組み合わせ (UF-MiPT)
- Metrohm インテリジェント濃縮技術 (MiPCT)
- Metrohm インテリジェント濃縮技術とマトリックス除去 (MiPCT-ME)
- Metrohm インテリジェントピックアップ注入テクニック (MiPut)
- Metrohm インライン中和と Metrohm インライン陽イオン除去
- Metrohm インテリジェント濃縮技術とインライン中和 (MiPCT-NE)

OMNIS MISP Unit では、限外ろ過セル、透析セル、移送チューブまたは移送キャピラリーを使用できます。オプションの MISP ホルダーを用いて、Metrohm で入手できるすべてのトラップカラムを取り付けることができます。オプションの MISP ベースプレートには、様々なコネクタを固定し、フローパスに統合させることができます。

オプションアクセサリ

6.01532.110

移送チューブ 10 mL、FEP、
M6



MISP Unit に取り付けて、液体を転送したり、一時的に保管したりするための移送チューブ 10 mL、FEP、M6。ドージングユニットの汚れを防止します。

FEP チューブは化学的に不活性であり、柔軟性があります。このチューブは、キャピラリーより内径が大きいため、大量の液体をより迅速に送液することができます。

代表的なアプリケーション:

濃縮技術 (MiPCT)

希釈技術 (MIDT)

6.01532.120

移送チューブ 10 mL、PEEK、
外径 1/8"



MISP Unit に取り付けて、液体を転送したり、一時的に保管したりするための移送チューブ 10 mL、PEEK、外径 1/8"。ドージングユニットの汚れを防止します。

PEEK チューブは化学的に不活性であり、フッ化物による汚染の可能性を防止するため、PTFE (FEP/PFA) チューブの代わりに使用されます。このチューブは、キャピラリーより内径が大きいため、大量の液体をより迅速に送液することができます。

代表的なアプリケーション:

濃縮技術 (MiPCT)

6.01532.130

移送チューブ 5 mL、FEP、外
径 1/8"



MISP Unit に取り付けて、液体を転送したり、一時的に保管したりするための移送チューブ 5 mL、FEP、外径 1/8"。ドージングユニットの汚れを防止します。

FEP チューブは化学的に不活性であり、柔軟性があります。このチューブは、キャピラリーより内径が大きいため、大量の液体をより迅速に送液することができます。

代表的なアプリケーション:

濃縮技術 (MiPCT および MiPCT-ME)

希釈技術 (MIDT)

6.01532.140

**移送チューブ LQH、FEP、外径
1/8"**



MISP Unit に取り付けて、液体を転送したり、一時的に保管したりするための移送チューブ LQH、FEP、外径 1/8"。ドージングユニットの汚れを防止します。

FEP チューブは化学的に不活性であり、柔軟性があります。このチューブは、キャピラリーより内径が大きいため、大量の液体をより迅速に送液することができます。

代表的なアプリケーション:

希釈技術 (MIDT)

6.01562.100

転送キャピラリー 2 mL、PEEK



MISP Unit に取り付けて、液体を転送したり、一時的に保管したりするための転送キャピラリー 2 mL、PEEK。ドージングユニットの汚れを防止します。

PEEK チューブは化学的に不活性であり、フッ化物による汚染の可能性を防止するため、PTFE (FEP/PFA) チューブの代わりに使用されます。このチューブは、キャピラリーより内径が大きいため、大量の液体をより迅速に送液することができます。

代表的なアプリケーション:

パーシャルループ技術 (MiPT)

濃縮技術 (MiPCT)

6.02006.100

MISP ベースプレート



OMNIS MISP Unit を T 字コネクタに固定するためのベースプレート。

6.02006.110
MISPホルダー、トラップカラム

OMNIS MISP Unit をトラップカラムに固定するためのホルダー。



6.02729.110
限外ろ過セル2

858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus
と一緒に用いたサンプルのインライン限外ろ過用。シリンジフィルターによる手間のかかる手動フィルタリングに対する代替法。



6.05331.010
OMNIS IC装置：D-INJ、DD

OMNIS ICのフルルーピングジェクション用付属品セット：このテクニックでは、OMNIS Dosing Drive UnitとOMNISシリンダーユニットを組み合わせることで、サンプルループを充填することができます。

前提条件：

OMNIS IC AS/ASCOOLを搭載したOMNIS IC S/M/Lには以下が含まれます：

- 利用可能なOMNIS Dosing Drive Unit
- 利用可能なOMNIS MISP Unit



6.05331.030

OMNIS IC装置：UF、PP/DD



OMNIS ICの限外ろ過用付属品セット：インライン限外ろ過により、サンプルから含有粒子を分離することができます。Metrohm インライン限外ろ過システムの主要コンポーネントは、限外ろ過セルです。この限外ろ過セルは、ろ過効率とサンプル処理能力に対する要求が高いサンプルのろ過に適しています。本装置は、Peristaltic Pump UnitとDosing Drive Unitを組み合わせてセットアップするためのものです。

前提条件：

OMNIS IC AS/ASCOOLを搭載したOMNIS IC S/M/Lには以下が含まれます：

- 利用可能なOMNIS Dosing Drive Unit
- 利用可能なOMNIS Peristaltic Pump Unitチャンネル
- 利用可能なOMNIS MISP Unit
- 3/2 方向制御バルブを搭載したAS/ASCOOL、UNF

6.05331.040

OMNIS IC装置：MIDT



OMNIS ICの希釈用付属品セット：このテクニックにより、イオン濃度が極端に高いイオンや、高濃度のサンプルマトリックスを希釈することが可能になります。必要なサンプル容量は、OMNIS Dosing Drive Unitによって正確に吸引されます。

サンプルと希釈溶液は希釈ステーションにて混合され、サンプルが希釈されるとともに、完全に均一化されます。さらに、Metrohm インライン希釈テクニックを用いることで、単一の標準液によるキャリブレーションが可能です。

仕様：

- 最大希釈率：2000
- 精度：DF 100までは<1.5%、DF 1000までは<2.5%
- 再現性（n=9）：DF 1000までは<1%
- キャリーオーバー：< 0.003%

前提条件：

OMNIS IC S/M/Lには以下が含まれます：

- 利用可能なOMNIS Dosing Drive Unit
- 利用可能なOMNIS MISP Unit

AS/ASCOOL装備：

- 希釈ステーションおよび
- 3/2 方向制御バルブ、M6

6.05331.050

OMNIS IC装置：UF、PP/PP



OMNIS ICの限外ろ過用付属品セット：インライン限外ろ過により、サンプルから含有粒子を分離することができます。Metrohm インライン限外ろ過システムの主要コンポーネントは、限外ろ過セルです。この限外ろ過セルは、ろ過効率とサンプル処理能力に対する要求が高いサンプルのろ過に適しています。本装置は、Peristaltic Pump Unitを用いたセットアップ専用です。

前提条件：

OMNIS IC AS/ASCOOLを搭載したOMNIS IC S/M/Lには以下が含まれます：

- 利用可能なOMNIS Peristaltic Pump Unitの2チャンネル
- 利用可能なOMNIS MISP Unit

6.05331.060

OMNIS IC装置：MIDT-UF、PP/DD



OMNIS ICにおける希釈と限外ろ過の組み合わせ用付属品セット：このテクニックにより、イオン濃度が極端に高いイオンや、高濃度のサンプルマトリックスを希釈することが可能になります。必要とされるサンプル容量は、OMNIS Dosing Drive Unitによって正確に吸引されます。

さらに、インライン限外ろ過により、サンプルをそこに含まれる粒子から分離することができます。この複合テクニックにより、わずか1種類の標準液でキャリブレーションを行うことが可能になります。

前提条件：

OMNIS IC AS/ASCOOLを搭載したOMNIS IC S/M/Lには以下が含まれます：

- 利用可能なOMNIS Dosing Drive Unit
- 利用可能なOMNIS Peristaltic Pump Unitチャンネル
- 利用可能なOMNIS MISP Unit
- 希釈ステーションおよび3/2 方向制御バルブを搭載したAS/ASCOOL、M6

6.05331.070

OMNIS IC装置：MiPT



OMNIS IC パーシャルループインジェクション用付属品セット：このテクニックにより、250 μ Lのサンプルループに規定の容量を充填することが可能です。OMNIS Dosing Drive Unitは、装着されたOMNISシリンダーユニットとともに、正確な吐出手順を行います。インテリジェントパーシャルループインジェクションテクニックは、インジェクション量を自由に選択できるため、単一の標準液でのキャリブレーションが可能です。サンプル注入についても同様です。高濃度のサンプルには少なめのインジェクション量を選択し、低濃度のサンプルには多めのインジェクション量を選択することができます。

前提条件：

OMNIS IC AS/ASCOOLを搭載したOMNIS IC S/M/Lには以下が含まれます：

- 利用可能なOMNIS Dosing Drive Unit
- 利用可能なOMNIS MISP Unit

6.05331.080

OMNIS IC 機器：UF-MiPT、PP/DD



OMNIS ICにおけるパーシャルループインジェクションテクニックと限外ろ過の組み合わせ用付属品セット：インライン限外ろ過により、サンプルから含有粒子を分離することができます。さらに、パーシャルループインジェクションを用いることで、250 μ Lのサンプルループにろ過済みサンプルの規定容量を充填することが可能です。OMNIS Dosing Drive Unitは、装着されたOMNISシリンダーユニットとともに、正確な吐出手順を行います。この複合テクニックにより、単一の標準液を用いたキャリブレーションが可能になります。

前提条件：

OMNIS IC AS/ASCOOLを搭載したOMNIS IC S/M/Lには以下が含まれます：

- 利用可能なOMNIS Dosing Drive Unit
- 利用可能なOMNIS Peristaltic Pump Unitチャンネル
- 利用可能な OMNIS MISP Unit
- 3/2 方向制御バルブ、UNF を搭載したAS/ASCOOL